(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2017-5135

(P2017-5135A)

(43) 公開日 平成29年1月5日(2017.1.5)

(51) Int.Cl.		FΙ			テーマコード (参考)
HO1L 23/36	(2006.01)	HO1L	23/36	С	5 E 3 2 2	
HO1L 33/64	(2010.01)	HO1L	33/00	450	5F136	
HO1L 23/12	(2006.01)	HO1L	23/12	J	5F142	
HO5K 7/20	(2006.01)	HO5K	7/20	М		

審査請求 未請求	請求項の数 5	ΟL	(全 24 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2015-118280 (P2015-118280) 平成27年6月11日 (2015.6.11)	(71) 出願人	504258527 国立大学法人 鹿児島大学 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
		(71) 出願人	000180313
			四国計測工業株式会社
			香川県仲多度郡多度津町南鴨200番地1
		(74)代理人	100123984
			弁理士 須藤 晃伸
		(74)代理人	100102314
			弁理士 須藤 阿佐子
		(72)発明者	水田 敬
			鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
			国立大学法人 鹿児島大学内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】電子部品実装基板の放熱設計方法およびプログラム

(57)【要約】 (修正有)

(19) 日本国特許**庁(JP)**

【課題】電子部品実装基板の温度ムラの問題を解決する ことができる電子部品実装基板の放熱設計方法及びプロ グラムを提供する。

【解決手段】基板及び基板上に集積実装された多数個の 半導体素子を備える電子部品実装基板の設計方法におい て、設計パラメータが、基板温度分布、基板面方向熱伝 導率、基板厚さ方向熱伝導率、基板サイズ、基板厚さ、 被冷却体サイズ、入熱量及び総括伝熱係数を含み、前記 設計パラメータの中から選択された一の未知パラメータ を除く設計パラメータに値を入力し、基板の温度分布及 び温度ムラを算出する。

【選択図】図 3



【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板および基板上に集積実装された多数個の半導体素子を備える電子部品実装基板の設計方法において、

(2)

設計パラメータが、基板温度分布、基板面方向熱伝導率、基板厚さ方向熱伝導率、基板 サイズ、基板厚さ、被冷却体サイズ、入熱量、および総括伝熱係数を含み、

前記設計パラメータの中から選択された一の未知パラメータを除く設計パラメータに値 を入力し、

下記式1により算出される前記基板のビオ数Bi_r、計算用パラメータa、および無次
 元座標r^{*}を算出し、

下記式2により前記計算用パラメータaおよび前記無次元座標r^{*}を用いて無次元温度 を算出し、無次元温度 に基づき前記基板の温度分布および温度ムラを算出することを 特徴とする電子部品実装基板の放熱設計方法。 「式1]

 $Bi_r = \frac{hR}{k_r}$ $a = Bi_r \frac{R}{d}$ $r^* = \frac{r}{R}$

[式2]

$$\theta = \frac{I_0(\sqrt{a}r^*)}{I_0(\sqrt{a})}$$

ここで、各係数は、以下に示すとおりである。 h:総括伝熱係数[W/(m²・K)] k_r:基板面方向熱伝導率[W/(m・K)] R:被冷却体サイズ[m] d:基板厚さ[m] I₀:第1種変形ベッセル関数 【請求項2】 基板および基板上に集積実装された多数個の半導体素子を備える電子部品実装基板の設

計方法において、

ビオ数に対する基板の温度ムラの近似曲線を算出し、

前記近似曲線および基板の温度ムラの狙い範囲からビオ数の範囲を算出し、

算出したビオ数の範囲に基づき下記式3により基板の有効熱伝導率 k_e [W/(m・K)]または筐体の総括伝熱係数 h [W/(m²・K)]を算出することを特徴とする電子部品実装基板の放熱設計方法。

[式3]

$$\operatorname{Bi}_r = \frac{hR}{k_e}$$

ここで、各係数は、以下に示すとおりである。 h :総括伝熱係数[W / (m² ・K)] k _e :基板有効熱伝導率[W / (m ・K)] 10

30

20

R: 被冷却体サイズ [m]

【請求項3】

前記設計パラメータが、さらに、基板最高温度、基板温度ムラ、環境温度、および被冷 却体面積を含むことを特徴とする請求項1に記載の電子部品実装基板の放熱設計方法。 【請求項4】

前記電子部品実装基板が、基板上に集積搭載された数十個以上のLEDチップ、LED チップを覆う透光性樹脂部、および、基板上に形成された配線層を有するLED発光モジ ュールと、LED発光モジュールが搭載された筐体とを備えるLED発光モジュールであ ることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の電子部品実装基板の放熱設計方 法。

【請求項5】

コンピュータに、請求項1ないし4のいずれかに記載の電子部品実装基板の放熱設計方 法を実行させるコンピュータプログラム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は電子部品実装基板の放熱設計方法およびプログラムに関する。

【背景技術】

[0002]

電子機器は、空間利用効率や機能性の向上を目的として、小型化が急速に進んでいる。 機器の小型化に伴い、内部の電子部品の基板実装密度は増加する。電子部品からは、仕事 に変換されなかったエネルギーが熱として放出される。特に、パワーエレクトロニクスの 様に、動作効率は高いが、投入エネルギーが非常に大きな場合や、高輝度LED(Lig ht Emittinng Diode)のように、動作効率が低い場合においては、当 該電子部品から発生する熱量が多いため、機器温度の上昇、ひいては、温度上昇に伴う短 寿命化や動作効率の低下を招きやすい。

特に、機器の小型化を実現するために、電子部品の基板実装密度を増大させると、電子 部品同士が熱的に干渉し、電子部品を実装している領域の概中央部の温度が、周辺部の温 度に比べて高くなるというように、基板内温度分布が非均一になる。 【0003】

一般に、電子部品の動作効率および寿命は温度に依存し、温度が高くなると動作効率の 低下、短寿命化を引き起こす。したがって、基板内温度が非均一な状態となると、動作効 率および寿命が均一でなくなる。かかる状態において、基板内で温度が最も高い場所にお いても所望の信頼性を確保するためには、当該部分の温度を規定値以下に抑制する必要が あるが、その場合、周辺部については、基板内温度の非均一性より、規定値に比べて過剰 に温度を低く抑制している状態となるため、ヒートシンクなどをはじめとする放熱系が過 剰性能となり、結果的に、放熱系、ひいては、機器全体の小型化を阻害する。 【0004】

また、LED光源基板において温度分布の不均一性(温度ムラ)が生じると、LEDの ⁴⁰ 動作効率、すなわち、発光効率の不均一性につながるため、結果的に、光源基板内に輝度 むらが生じ、光源の品質低下を招く。さらに、LEDチップの基板実装密度を増大させる と、チップ同士が熱的に干渉し、基板の略中央部の温度が周辺部に比べて高くなり、「ド ーナツ化現象」と呼ばれる中央部の発光量の低下の問題や短寿命化の問題が生じる。 したがって、小型化、動作効率・品質の向上を図るためには、基板内温度分布を均一に

すること(温度ムラを一定の範囲に抑えること)が肝要である。 【0005】

従来、基板温度平滑化には、銅などの高熱伝導性の金属を基板内に内包したメタルコア 基板や、潜熱輸送型の熱伝導部材であるベーパーチャンバーなどのフラットヒートパイプ が使用されてきた。

20

10

例えば、特許文献1では、上板及び下板のうちいずれか一方に被冷却装置を設けるため の配置部を有し、前記上板と前記下板との間に1又は複数の中板を設けた冷却部本体を備 え、前記冷却部本体の内部には、冷媒が蒸気となって前記被冷却装置で発生する熱を前記 冷却部本体の周辺部に伝達する蒸気拡散流路と、前記中板に設けられ、前記周辺部で凝縮 した冷媒が前記配置部側に戻るように構成された毛細管流路とが設けられており、前記配 置部には、他の領域よりも厚みが薄く形成され、前記被冷却装置を搭載させるための凹部 を備えるヒートパイプが提案されている。

[0006]

放熱設計には、シミュレーションがよく用いられている。しかし、シミュレーションに よる試行錯誤的な設計の場合、多くの因子について検討を行う必要があり、膨大な計算コ ストがかかるため、現実的な計算時間・コストのもとでは最適化が困難となる場合が多々 あった。

そこで、特許文献2では、加熱端から冷却端までの熱伝導を1次元熱伝導としてモデル 化して領域毎の放熱量を求め、加熱端から冷却端までの熱伝導状態を解析することを特徴 とするプレート型ループ状細管ヒートパイプの解析方法が提案されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0007]

【特許文献1】特許第4119944号公報

【特許文献2】特開平10-222492公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$

電子部品実装基板の放熱設計においては、基板サイズ、入熱量、熱源サイズ(実装エリ ア)、許容される温度不均一性、基板の熱伝導率、基板冷却条件、ピーク温度等の設計パ ラメータを考慮する必要がある。しかしながら、これら設計パラメータの最適化を図るた めには、複雑な計算を繰り返し行う必要があり、多大な労力を要していた。

未知のパラメータがある中で、基板の温度ムラを一定の範囲に抑えるための放熱設計を 迅速に行うことのニーズがあるが、このニーズを解決するための設計手法はこれまで提案 されていない。

【 0 0 0 9 】

そこで、本発明は、電子部品実装基板の温度ムラの問題を解決することができる電子部 品実装基板の放熱設計方法およびプログラムを提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

第1の発明は、基板および基板上に集積実装された多数個の半導体素子を備える電子部 品実装基板の設計方法において、設計パラメータが、基板温度分布、基板面方向熱伝導率 、基板厚さ方向熱伝導率、基板サイズ、基板厚さ、被冷却体サイズ、入熱量、および総括 伝熱係数を含み、前記設計パラメータの中から選択された一の未知パラメータを除く設計 パラメータに値を入力し、下記式1により算出される前記基板のビオ数Bir、計算用パ ラメータa、および無次元座標r*を算出し、下記式2により前記計算用パラメータaお よび前記無次元座標r*を用いて無次元温度 を算出し、無次元温度 に基づき前記基板 の温度分布および温度ムラを算出することを特徴とする電子部品実装基板の放熱設計方法 である。

[式1]

20

10

$\mathrm{Bi}_r = \frac{hR}{k_r}$	
$a = Bi_r \frac{R}{d}$	
$r^* = \frac{r}{R}$	
[式2]	
$\theta = \frac{I_0(\sqrt{a}r^*)}{I_0(\sqrt{a})}$	
ここで、各係数は、以下に示すとおりである。	
h : 総括伝熱係数[W/(m ² ・K)]	
K _r :	
d:基板厚さ[m]	
I ₀ :第1種変形ベッセル関数	
【 O O 1 1 】	
第2の発明は、基板および基板上に集積実装された多数個の半導体素子を備える電子	· 部
品実装基板の設計方法において、ビオ数に対する基板の温度ムラの近似囲線を昇出し、 記近似曲線お上が其板の温度ムラの狙い範囲からビオ数の範囲を算出し、算出したビオ	月 〒 米カ
記 辺 似 曲 緑 の よ び 基 攸 の 温 良 ム フ の 狙 い 軋 囲 か ら と オ 奴 の 軋 囲 を 昇 击 し 、 昇 击 し に と オ の 箭 囲 に 其 づ き 下 記 式 3 に よ り 其 板 の 有 动 執 伝 道 率 k 「 W / (m・ K)」 ま た は 筐 体	ξX ΓΩ
総括伝熱係数h $[W / (m^2 \cdot K)]$ を算出することを特徴とする電子部品実装基板の	、0))放
熱設計方法である。	
[式3]	
hR	
$\operatorname{Bi}_r = \frac{1}{k}$	
・ <i>ne</i> ここで 各係数は 以下に示すとおりである	
h:総括伝熱係数「W/(m ² ·K)]	
k _e : 基板有効熱伝導率 [W / (m ・ K)]	
R : 被 冷 却 体 サ イ ズ [m]	
第3の発明は、前記設計パラメータが、さらに、基板最高温度、基板温度ムラ、環境	記
度、およひ被冷却体面積を含むことを特徴とする第1の発明の電子部品実装基板の放棄	い
計力法でのる。式3で奉攸有効熱伝導率を用いているのは、奉攸熱伝導率の共力性に て評価が困難であり、右効熱伝道変のみ開示されている提合に対する対応のためである) ()
第4の発明は、前記電子部品実装基板が、基板上に集積搭載された数十個以上のLF	'。 . D
チップ、LEDチップを覆う透光性樹脂部、および、基板上に形成された配線層を有す	- 3
LED発光モジュールと、LED発光モジュールが搭載された筐体とを備えるLED発	≜光
モジュールであることを特徴とする第1ないし3のいずれかの発明の電子部品実装基板	ίの
放熱設計方法である。	
第 5 の 発 明 は 、 コ ン ビ ュ ー タ に 、 第 1 な い し 4 の い ず れ か の 発 明 の 電 子 部 品 実 装 基 栃	
故 최 과 러 수 다 수 다 주 ㅋ ヽ, ピュー ク 귀 ㅁ ビ ㅋ ノ ㅋ キ ㅋ	えの

(5)

【0013】

本発明によれば、電子部品実装基板の温度ムラを一定の範囲に抑えるための放熱設計を 迅速に行うことが可能となる。 【図面の簡単な説明】 [0014]【図1】LED照明モジュールを熱的評価する場合の構成図である。 【図2】熱設計プログラムの入出力画面を示す図である。 【図3】熱設計プログラムの処理のフローチャートである。 【図4】熱設計プログラムの計算処理の詳細なフローチャートである。 【図5】実施例1および2に係るLED照明モジュールの上面図である。 【図6】実施例1および2に係るLED照明モジュールの断面図である。 【図7】実施例1および2に係るLED照明モジュールのLEDチップの実装パターンを 表す図である。 【図8】実施例1に係るLED照明モジュールの基板の温度分布を実測した結果を示す図 である。 【図9】実施例1および2に係るLED照明モジュールの基板の温度分布の解析解と実測 結果を比較したグラフである。 【図10】実施例3に係る水中高輝度LED照明の(a)斜視図、(b)平面図、(c) 断面図である。 【図11】実施例3に係る水中高輝度LED照明の受熱部および基板の(a)上面図、(b)側面図、(c)下面図である。 【図12】実施例3に係る水中高輝度LED照明の温度ムラのシミュレーション結果であ る。 【発明を実施するための形態】 [0015]本発明は、電子部品実装基板の温度分布を平滑化し、実装された半導体素子の動作状況 を均一にすることを可能とするための放熱系設計手法を提供するものである。この放熱系 設計手法は、コンピュータ上で実行される専用プログラムにより実現されるものであって 、基板内で許容される最高温度と温度ムラを与えることにより、基板に要求される熱伝導 率および基板を配置するケーシングに求められる放熱性能を定量化することを可能とする ものである。本発明は、LED光源システムやインバータ等のパワーエレクトロニクスを 用いたシステムなど、電子機器全般に適用することが可能であるが、以下ではLED照明 モジュールの熱設計例を説明する。 [0016][熱設計プログラム] 実施形態例に係る熱設計プログラムは、パーソナルコンピュータ上で実行されるプログ ラムであり、本実施形態例に係る熱設計方法を実行することができる。設計パラメータと して、4つの大きさに関する条件と、7つの熱的条件を入力することができる。この11 個の設計パラメータのうち、10個のパラメータを入力することで、1個の未知パラメー タXを本発明のアルゴリズムに基づき自動で算出する機能を有している。未知パラメータ Xは、11個の設計パラメータの中から任意のパラメータを選択することが可能である。 熱設計プログラムのパラメータ入力画面、各パラメータ、およびアルゴリズムの詳細につ いては後述する。 [LED照明モジュール] 図1に本LED照明モジュール1の(a)平面図、(b)側面図を示す。LED照明モ ジュール1は、多数個のLEDチップが配置される実装領域10および基板20を主な構 成要素とし、一定温度に管理された液冷クーラー(30~33)を用いて熱的特性を評価

実装領域10は、多数個のLEDチップが高密度で実装される領域であり、一つの発熱体として近似される。

される。

(6)

20

10

30

40

基板20は、実装領域10が実装され、実装領域10が発した熱を液冷クーラーの金属 ブロック30に伝える役割を担っている。

液冷クーラーの金属ブロック30は、基板20の裏面20B(実装領域10が実装された面とは反対側の面)の温度を一定に保つために用いられ、例えばアルミや銅等の熱伝導率の良い金属からなるブロックを主要な構成要素とする。液冷クーラーの金属ブロック30内には、例えば不凍液等の冷媒が通る循環流路31が設けられており、循環流路31の入口32および出口33は、図示しない外部のサーキュレータに管で接続されている。冷媒は、サーキュレータ内のポンプによって送り出され、循環流路31とサーキュレータの間を循環する。サーキュレータは、液冷クーラーの金属ブロック30の温度を一定に保つために、サーキュレータ内に挿入された図示しない温度センサにより測定された温度を監視しながら、冷媒の温度を制御する。液冷クーラーの金属ブロック30の表面30Aには、熱抵抗を低くするためのサーマルグリス(図示せず)が塗ってあり、基板20はサーマルグリスを介して液冷クーラーの金属ブロック30に固着されている。

本実施形態例における設計パラメータについて、図1を参照しながら以下に説明する。 【0019】

[L h s:基板サイズ]

基板サイズL_{h。}は、基板20の最大長さの半分の値と定義する。したがって、基板の 形状は図示の形状に限定されず、例えば、多角形やL字形であってもよく、この場合も最 大長さに基づき基板サイズL_{h。}を設定する。基板サイズL_{h。}は、冷却能力に影響し、 大きいほど冷却能力が優れるが、小型化を妨げることになるので、サイズと冷却能力のバ ランスを考慮して設計する。

[d:基板厚さ]

基板厚さdは、基板20の厚さと定義する。基板厚さdが厚いほど、基板20の基板面 方向熱抵抗が低下するため、装領域10の温度分布を均一化させやすいが、基板厚さ方向 熱抵抗が増加するため、面方向と厚さ方向の熱抵抗のバランスを考慮して設計する。 「R:被冷却体サイズ]

被冷却体サイズRは、実装領域10の大きさの半分の値と定義する。被冷却体サイズRは、同一発熱量であれば、大きいほど冷却されやすいが、光束量等の仕様やLEDチップの実装密度等も考慮して設計する。

[A : 被 冷 却 体 面 積]

被 冷 却 体 面 積 A は、 実 装 領 域 1 0 の 占 め る 面 積 で あ る 。 設 計 の 考 え 方 は 、 被 冷 却 体 サ イ ズ R と 同 様 で あ る 。

[0020]

[Q_i_n:入熱量]

入熱量Q_inは、実装領域10から基板20に移動する熱の総量である。実装領域10 に投入したエネルギーのうち、光に変更されない一定割合のエネルギーが熱として生じる。生じた熱は、実装領域10の周囲の空気および基板20に伝熱するが、通常の電子機器における実装の場合は90%程度が基板側に移動するため、かかる場合、Q_inは発熱量の90%程度と設定する。また、本LED照明モジュール1の様に、基板裏面の冷却に液冷クーラーや高性能ヒートシンク等を使用する場合には、空気への伝熱は小さいので無視し、生じた熱はすべて基板20に伝熱すると仮定する。入熱量Q_inは、LEDチップの発光効率、消費電力、搭載個数等によって決まる。

[T : 環境温度]

環境温度 T は、液冷クーラーの金属ブロック30の温度である。設計においては、使 用環境温度を用いて検討する。

[k_r:基板面方向熱伝導率、k_z:基板厚さ方向熱伝導率、k_e:基板有効熱伝導率]
 基板面方向熱伝導率k_rは基板20の面方向熱伝導率であり、基板厚さ方向熱伝導率k
 zは基板20の厚さ方向熱伝導率である。基板20に高性能ヒートパイプ型ヒートスプレッダ(Fine Grid Heat Pipe:FGHP)やグラファイト製品等を基

10

板として用いる場合、熱伝導率には構造的な要因から面方向と厚さ方向で異方性があるため、別々のパラメータとして用意した。基板有効熱伝導率k_。は、面方向と厚さ方向の熱 伝導率が実質的に等価と仮定した場合の熱伝導率である。

【 0 0 2 1 】

[h : 基板裏面冷却強度]

基板裏面冷却強度hは、基板20から液冷クーラーの金属ブロック30への伝熱効率を 表す係数であり、本LED照明モジュール1においては総括伝熱係数と等価である。基板 20の形状や表面状態、基板20が接触する流体(例えば、空気)で決まる定数である。 【0022】

「T:基板温度分布]

基板温度分布 T は、基板 2 0 の温度の分布である。後述する基板最高温度 T _{m a x}、基 板最低温度 T _{m i n}、および温度ムラ T _{m a x} - T _{m i n}は、基板温度分布 T に従属して 自動的に決まるため、これらは基板温度分布 T とともに 1 つの設計パラメータとして扱う

[T m a v : 基板最高温度]

基板最高温度 T_{max}は、基板 2 0 の温度の最大値である。基板 2 0 の温度は、LED チップの劣化に影響し、その値が大きいほど、LEDチップは劣化しやすく、寿命が低下 する。したがって、基板最高温度 T_{max}は、高くなりすぎないように設計する。 【 0 0 2 3 】

[T_mi_n:基板最低温度]

基板最低温度T_{min}:は、基板20の温度の最小値である。LED照明モジュールにおいては、温度の低い側については問題とならないが、基板最高温度T_{max}との差分としての温度ムラを算出するために検討が必要となる。

【0024】

[T_{max}-T_{min}:温度ムラ]

温度ムラ T_{max} - T_{min}は、LEDチップの発光量の差を生じさせ、照明品質を低下させる要因となる。さらに、基板内での温度ムラは、LEDチップや蛍光体、樹脂などの寿命にバラつきを生じさせる要因ともなる。したがって、温度ムラ T_{max} - T_{min}を許容範囲に抑えるように設計する。

基板最高温度 T_{max}と同様に、基板最低温度 T_{min}を基板 2 0 の温度の最小値と定 ³⁰ 義し、温度ムラ T_{max} - T_{min}を求める。

【0025】

[パラメータ入力画面]

図2に、熱設計プログラム(以下単に「プログラム」という場合がある)の入出力画面 40を示す。入出力画面40は、設計パラメータ名称欄41、設計パラメータ入出力欄4 2、設定欄43、計算結果表示欄44、および計算実行ボタン45を主な構成要素として いる。前述した設計パラメータに対応しており、同図中に各設計パラメータを表す記号を 付している。

設計パラメータ名称欄41は、前述した各設計パラメータが記載されており、同図中に 付した記号は、対応する設計パラメータを表す記号である。

設計パラメータ入出力欄42は、設計パラメータの固定値を入力したり、設計パラメー タをプログラムに計算させたときの解が出力されたりする欄である。

設定欄43は、リストボックスになっており、設計パラメータの値を設計パラメータ入 出力欄42に入力した値で固定したい場合には「左の値を使用する」を、設計パラメータ をプログラムに計算させたい場合には「・・・を求める」を選択できるようになっている 。後者を選択した場合、対応する設計パラメータ入出力欄42はグレーアウトし、以後入 力できないようになる。

計算結果表示欄44は、温度分布の計算結果を、座標と温度を並列させて表示する。計算結果表示欄44下部にある「毎回計算結果ウィンドウをリフレッシュする」のチェック ボックスをチェックすると、設計パラメータをプログラムに計算させたときに解が収束す 10

20

40

るまで実行中の計算結果を更新し続ける。 計算実行ボタン45は、クリックするとプログラムが計算を実行するものである。 【0026】 [処理フロー] 図3に熱設計プログラムの処理のフローチャートを示す。本プログラムは、設計パラメ ータのうちの1つを未知とし、与えられた温度ムラT_{max} - T_{min}の狙い値になるよ う、未知の設計パラメータを最適化するものである。また、温度ムラT_{max} - T_{min} が未知の場合、最適化は行わず、温度ムラT_{max} - T_{min}の計算値を返して終了する。 最適化のアルゴリズムとして二分法を用いたが、これに限定されるものではない。 図3の各処理に付したステップ番号(S1~S9)に沿って、図2を参照しながら説明 していく。 (S1)

各設計パラメータの中から、未知の設計パラメータXを1つ選択し、対応する設定欄4 3で「・・・を求める」を選択する。固定する設計パラメータの設計パラメータ入出力欄 42に、各設計パラメータの固定値を入力する。

(S2)

未知のパラメータが温度ムラ T_{max} - T_{min}であるか否か判定する。未知のパラメ ータが温度ムラ T_{max} - T_{min}である場合、 S 1 2 に進む。

- 【 0 0 2 7 】
- (S3)

未知パラメータXの区間上限X1と区間下限X2を設定する。区間上限X1と区間下限X2は、表1のように設計パラメータごとにあらかじめデータベースとして与えられており、データベースを参照することで設定される。

【表1】

設計パラメータ	区間下限	区間上限
基板サイズ[mm]	5	100
基板厚さ[mm]	0.1	50
	•••	•••

(S4)

区間上限X₁と区間下限X₂の中間点X_Mを計算する。X_Mの計算式は数1で与えられる。

【数1】

$$X_M = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

X_M:中間点

X ₁:区間上限

X₂:区間下限

【 0 0 2 8 】

(S5)

区間上限X₁、区間下限X₂、および中間点X_Mにおける基板温度分布T₁、T₂、およびT_Mを計算する。詳細な計算方法は、S51~S56として別途説明する。 (S6)

基板温度分布 T₁、 T₂、および T_Mより、温度ムラ Y₁、 Y₂、および Y_Mを計算す る。温度ムラ Y₁、 Y₂、および Y_Mの計算式は、数 2 で与えられる。 20

10

10

20

30

40

【数 2】 $Y_i = T_i max - T_i min$ (i = 1, 2, M)Y , : 温度ムラ「K] T_i m_{ax}:基板温度の最大値[K] T_i___min:基板温度の最小値[K] [0029](S7) 温度ムラ Y 1、 Y 2、および Y M と設計パラメータ入出力欄 4 2 で入力された温度ムラ Yの設定値Y。との差分値である残渣 Y₁、 Y₂、および Y_Mを計算する。残渣 Y₁、 Y₂、および Y_Mの計算式は、数3で与えられる。 【数3】 $\Delta Y_i = Y_i - Y_0$ (i = 1.2, M)Y , : 残渣 [K] Y 。:温度ムラの設定値[K] [0030](S8) 残渣 Y_Mが目標値 以下かどうか判定する。目標値 は精度によって決まり、小さい ほど、真の解に近づくが、計算回数が増える。目標値 は、例えば、0.01Kの値が与 えられる。残渣 Y_Mが目標値 以下の場合、精度は担保され、 X_Mを未知パラメータ X の解とし、S11に進む。残渣 Y_Mが目標値 より大きい場合、精度は満たされないこ とになり、再度計算するため、S9に進む。 (S9) 残渣 Y╷および Y₂の正負の符号が、互いに異なるか否かを判定する。残渣 Y╷ および Y₂の正負の符号が異なる場合、 Y = Y₀となる X の解が区間 X₁ ~ X₂の間に 存在することになる。残渣 Y╷および Y₂の正負の符号が同じ場合、Y=Y╻となる Xの解が区間X₁~X,の間に存在しないため、エラーを返してプログラムは終了する。 [0031](S10) 残渣 Y₁または Y₂のいずれかのうち、どちらが正負の符号が残渣 Y_Mの正負の 符号と等しくかを判定する。残渣 Y₁の正負の符号と残渣 Y_Mの正負の符号が等しい 場合は、区間下限X1の値をXMに変更し、区間上限X2の値はそのまま維持する。残渣 Y2の正負の符号と残渣 YMの正負の符号が等しい場合は、区間上限X2の値をXM に変更し、区間下限 X 1 の値はそのまま維持する。そして、 S 4 に戻る。 (S11) 未知パラメータ X の 設計パラメータ入出力欄 4 2 に 解 X M を表示し、 プログラムは終了 する。 (S12) 基板温度分布Tを計算する。計算方法はS51~56と同じである。 [0032](S13) 基板温度分布Tより、温度ムラYを求める。温度ムラYの計算式は、数4で与えられる

【数4】 $Y = T_{max} - T_{min}$ Y:温度ムラ「K] T_{max}: 基板温度の最大値 T ____ 、: 基板温度の最小値 [0033](S14) 温度ムラの設計パラメータ入出力欄42に温度ムラYを表示し、プログラムは終了する 10 [0034] S5および12の詳しい計算の過程S51~S56について、図4を参照しながら説明 する。 (S51) ビオ数 B i , を数 5 の式によって求める。 【数5】 $\operatorname{Bi}_r = \frac{hR}{k_r}$ B i r : ビオ数 20 h:基板裏面冷却強度[W/(m²・K)] R: 被冷却体サイズ [m] k r: 基板面方向熱伝導率 [W/(m・K)] [0035](S52) 計算用パラメータaを数6の式によって求める。 【数6】 $a = Bi_r \frac{R}{d}$ 30 a : 計算用パラメータ(ビオ数に関連) R: 被冷却体サイズ [m] d:基板厚み「m] [0036] (S53) 座 標 r を、 0 から 被 冷却 体 サイズ R の 間 の 値 で 一 定 数 ま た は 一 定 間 隔 で 分 割 し た 値 を 各 要素とする配列データとして定義する。数7によって、座標rを被冷却体サイズRで規格 化した無次元座標r*を計算する。 【数7】 40 $r^* = \frac{r}{R}$ r^{*}:無次元座標 r:座標[m] (S54)

無次元温度 を数8の式によって求める。

(11)

【数8】

$$\Theta = \frac{I_0(\sqrt{a}r^*)}{I_0(\sqrt{a})}$$

: 無 次 元 温 度

- I₀:第1種変形ベッセル関数
- 【0037】
- (S55)

被冷却体端位置(r^{*}=1)における温度T_Rを数9の式によって求める。 10 【数9】

$$\begin{split} T_R &= \frac{1}{A} \left(\frac{d}{S_{mod}k_2} + \frac{1}{h} \right) Q_{in} \\ T_R &: \overleftarrow{k} \langle ba k ~ \ddot{m} d (\Box \Box \Box \Box J) \\ k_z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \Box \Box A \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \Box \Box A \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \Box \Box A \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \Box \Box A \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \Box \Box A \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \Box \Box A \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \Box \Box A \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \Box \Box A \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \Box \Box A \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \Box \Box A \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \end{matrix} z \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \Box A \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \end{matrix} z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \u A \end{matrix} z \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \u A \end{matrix} z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \u A \end{matrix} z \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \u A \end{matrix} z \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \u A \end{matrix} z \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \u A \end{matrix} z \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \u A \end{matrix} z \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \u A \end{matrix} z \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta \u A \end{matrix} z \\ z &: \overleftarrow{k} \langle b \mu \Delta$$

(12)

図 5 における B - B 断面図である。

以下、図5および6を用いてLED照明モジュール1の構成を説明する。

【0042】

図 5 に示すように、LED照明モジュール1は、実装領域10、配線12(12a、12b)、外部接続端子13(13a、13b)、実装基板20、ダム材22を主な構成要素とする。

実装領域10は、高密度に所謂COB(Chip On Board)実装された22 10個のLEDチップ11の最外周を囲む領域であり、発光源かつ発熱源である領域であ る。実装領域10は、図5のA - A線を境に供給される電源が別々になっており、左側の 実装領域10aと右側の実装領域10aに分けられる。左側の実装領域10aと右側の実 装領域10aには、それぞれ1105個のLEDチップ11が実装されている。

L E D チップ1 1 は、例えば、 I n G a N 系青色 L E D ベアチップである。 L E D チッ プ1 1 は、 L E D チップ1 1 同士あるいは配線 1 2 (1 2 a、 1 2 b、 1 2 c、 1 2 d) とワイヤ 1 4 により電気的に接続されている。ワイヤ 1 4 は、例えば、金やアルミ等の金 属材料からなり、ワイヤボンディングにより形成および接合される。 L E D チップ 1 1 の 裏面(下面)は、基板 2 0 の表面上に高熱伝導性接着剤等により固設される。 L E D チッ プ 1 1 の配列については後述の [高密度実装]の箇所で説明する。

【0043】

配線12および外部電極端子13は、基板20の表面上に実装領域10を囲むように配設され、LEDチップ11に電源を供給する。配線12および外部電極端子13は、同一の符号(a、b、c、d)が付されたもの同士で電気的に接続されており、図5のA-A線を対称軸として一定間隔を空けて線対称なパターンを形成している。外部電極端子13 は、図示しない外部電源装置に電気的に接続され、外部電極端子13aと13b間、および外部電極端子13cと13d間に電圧が印加される。配線12aと12b間、および配線12cと12d間には、一定間隔が空けられ、過電圧による破壊防止のための保護ダイオード装置15が接続されている。また、配線12の表面上には、無機系白色絶縁層21 と同じ材料により構成され、ソルダーレジストとしても機能する無機系白色絶縁層24が形成されている。

【0044】

基板20は、直径 120mm、厚さ2mmの銅板で構成され、表面に形成された無機 ³⁰ 系白色絶縁層21により、電気的に絶縁するとともに低い熱抵抗で実装領域10の熱を伝 導し、裏面で放熱する。

【0045】

無機系白色絶縁層21は、基板20の表面上に塗布形成され、絶縁層および実装領域1 0で発光された光の反射層としての役割を担う。無機系白色絶縁層21は、白色系無機粉 末(白色系無機顔料)と二酸化珪素(SiO2)を主要な成分とし、耐電圧1KV/10 μm程度、可視光の波長域で平均反射率70%以上の物性を有する。無機系白色絶縁層2 1の厚さは、例えば、10~150μmであり、塗布形成には、例えば、インクジェット 法、ディスペンサー法、スプレーコート法またはスクリーン印刷法が用いられる。 【0046】

ダム材22は、基板20の表面上に実装領域10を囲む略正方形状に形成され、透光性 樹脂23を充填するための堤防として機能する。また、ダム材22の表面には光反射性が 付与され、実装領域10より発光された光を反射する。 【0047】

透光性樹脂23は、ダム材22により囲まれた領域に充填され、LEDチップ11とワ イヤ14を封止する。これにより、LEDチップ11、ワイヤ14およびこれらの接合部 を保護し、LEDチップ11から発光された光を所望の色に調節する。透光性樹脂23に は、例えば白色を得るための蛍光体が混入されている。白色光を得るための方式としては 、紫外LEDで三原色の蛍光体を励起する方式、緑および赤の二色の蛍光体を青色LED で励起する方式、黄色の蛍光体を青色LEDで励起する方式があるところ、LEDチップ

1 1 の種類に応じて選択された蛍光体を混入する。色温度は、例えば、 2 7 0 0 ~ 6 5 0 Kの範囲で設定する。 [0048][高密度実装] 図7を用いて、実装領域10に実装されたLEDチップ11の配列および電気接続につ いて説明する。 図 7 は、図 5 の第 1 実装領域 1 0 a に実装されたLEDチップ 1 1 と、配線 1 2 a 、 1 2 bを抜き出した簡略図である。第2反射領域10bに実装されたLEDチップ11も同 様の配列である。 10 [0049]LEDチップ11は、第1実装領域10a内の上下方向と左右方向にそれぞれ実質上等 ピッチで千鳥状に配置される。LEDチップ11は、奇数番目の行に32個、偶数番目の 行に33個並べられ、合計34行の行をなしている。奇数番目の行における左端のLED チップ11同士は、その左右方向の位置が同じである。また、偶数番目の行における左端 のLEDチップ11同士も、その左右方向の位置が同じである。さらに、奇数番目の行に おける左端のLEDチップ11は、偶数番目の行における左端のLEDチップ11に対し て実質上半ピッチ分右にずれている。 ここで、LEDチップ11の位置を定義する。図7に示すように、左上のLEDチップ 20 11を基準として、右方向にX方向、下方向にY方向を規定する。そして、基準からY番 目の行に属し、左端からX番目にあるLEDチップ11にインデックス(X,Y)を割り 当てる。 例えば、1行目に属するLEDチップ11は、左端からインデックス(1,1)、(2, 1)、(3,1)、・・・、(32,1)が割り当てられ、下端の行に属するLEDチッ プ11は、左端からインデックス(1,34)、(2,34)、(3,34)、・・・、 (33,34)が割り当てられる。 以下、インデックス(X,Y)を割り当てられたLEDチップ11を「LEDチップ11 (X,Y)」と表記することとする。 **[**0051**]** 30 LEDチップ11(X,Y)は、下記のように配線12a、12bに対してワイヤボン ドにより直列に電気接続される。 Y = 1 または 2 の場合、LEDチップ11(X,Y)のチップ上端にある一対の電極(図示せず)は配線12aとワイヤボンドされる。 Y 32の場合、LEDチップ11(X,Y-2)のチップ下端にある一対の電極 3 (図示せず)は、LEDチップ11(X,Y)のチップ上端にある一対の電極(図示せず)とワイヤボンドされる。また、LEDチップ11(X, Y)のチップ下端にある一対の 電極(図示せず)は、LEDチップ11(X,Y+2)のチップ下端にある一対の電極(図示せず)とワイヤボンドされる。 Y = 3 3 または 3 4 の場合、 L E D チップ 1 1 (X, Y)のチップ下端にある一対の電 40 極(図示せず)は配線12bとワイヤボンドされる。 【0052】 以上のように、LEDチップ11同士が上下に1行おきに電気接続されるため、配線1 2 a 、 1 2 b に対して 1 7 個 直 列 に 電 気 接 続 さ れ る 。 こ れ ら 1 7 個 直 列 に 電 気 接 続 さ れ た LEDチップ11を「単位LEDチップ群」と定義すると、単位LEDチップ群は、奇数 行群で同一のインデックスXが割り当てられたLEDチップ11、または偶数行群で同一 のインデックスXが割り当てられたLEDチップ11により構成される。インデックスX の値は、奇数行においてはX=1~32、偶数行においてはX=1~33をとるため、単 位LEDチップ群は、奇数行群で32個形成され、偶数行群で33個形成される。第1実

。各単位LEDチップ群は、配線12a、12bに対して並列に電気接続されているので

、 第 1 実 装 領 域 1 0 a に は 、 1 1 0 5 個 の L E D チ ッ プ 1 1 が 1 7 直 列 × 6 5 並 列 の 配 線 パターンで実装されていることになる。

第2実装領域10bも第1実装領域10aと同様の構成であるので、両領域合わせた実 装領 域 1 0 に は 、 2 2 1 0 個 の L E D チ ッ プ が 1 7 直 列 x 1 3 0 並 列 で 実 装 さ れ て い る こ とになる。

[0053]

「解析結果]

熱設計プログラムに入力した本実施例の各設計パラメータを、表2に示す。未知パラメ ータは基板温度分布 T であるため、従属する基板最高温度 T m a x と温度ムラ T m a x -T_﹔」は未知パラメータとしてプログラムに入力していない。 【表2】

設計パラメータ	実施例1
基板サイズL _{hs} [mm]	60
基板厚さd[mm]	2
被冷却体サイズR[mm]	32.64
被冷却体面積A[mm²]	4351.565
入熱量Q _{in} [W]	700.7
環境温度T _∞ [K]	333.15
基板面方向熱伝導率k,[W/(m・K)]	386
基板厚さ方向熱伝導率k _z [W/(m・K)]	386
基板裏面冷却強度h[W/(m²・K)]	2210
基板内最高温度T _{max} [K]	_
基板内温度ムラT _{max} ーT _{min} [K]	—

[0054]

図8は、本実施例のLED照明モジュール1における、定常状態での基板20の温度分 布をサーモグラフィにより実測した結果である。図8(a)は、基板20の温度分布をコ ンター表示した図であり、(b)は(a)の2つのパスA、Bの温度分布をグラフにプロ ットしたもの(上段:パスA、下段:パスB)である。図8(b)を見て分かるように、 基板20の中心を通るパスAとBとで、温度分布に差異はなく、設計検討に用いるパスは パスA、Bのいずれでもよい。したがって、設計検討に用いるパスとして、便宜のため、 パスBを用いることにし、基板最高温度T__、は、パスBにおける基板20の温度の最 大値と定義する。

図 9 に、本実施例のLED照明モジュール 1 の基板温度分布 T を熱解析プログラムによ って求めた結果(点線)を、実機の実測結果(実線)とともに示す。座標0 r * < 0. 1 付 近 に お い て 、 実 機 で は 図 5 の A - A 線 付 近 に 一 定 間 隔 を 空 け て い る も の の 、 解 析 プ ロ グラムでは均一に発熱すると近似しているため、実機の温度分布を再現できていない。し かし、実機の測定結果に対する解析結果の平均誤差は2.6%であり、その他の領域にお いては精度よく再現できていることが分かる。

【実施例2】

[0055]

実 施 例 2 は、 LED照 明 モ ジュール 1 の 基 板 2 0 を、 FGHPで構 成 した 場合の シミュ レーション結果を示すものである。以下では、実施例1との相違点を中心に説明し、共通 する構成についての説明は割愛する場合がある。

[0056]

「構造]

基板20は、特許文献1のFGHPを直径120mm、厚さ2mmの大きさとしたもの である。FGHP内部にはヒートパイプを有し、高い熱伝導率が得られるため、熱の拡散 50

10

を生じやすく、温度ムラの低減を狙っている。

- 【 0 0 5 7 】
- [解析結果]

熱設計プログラムに入力した本実施例の各設計パラメータを、表3に示す。未知パラメータは基板温度分布Tであるため、従属する基板最高温度Tmaxと温度ムラTmax Tminは未知パラメータとしてプログラムに入力していない。 【表3】

設計パラメータ	実施例2
基板サイズL _{hs} [mm]	60
基板厚さd[mm]	2
被冷却体サイズR[mm]	32.64
被冷却体面積A[mm²]	4351.565
入熱量Q _{i∩} [W]	698.6
環境温度T _∞ [K]	333.15
基板面方向熱伝導率k,[W/(m・K)]	16000
基板厚さ方向熱伝導率k _z [W/(m・K)]	6700
基板裏面冷却強度h[W/(m²・K)]	2210
基板内最高温度T _{max} [K]	—
基板内温度ムラT _{max} ーT _{min} [K]	—

図9に、本実施例のLED照明モジュール1の基板温度分布Tを熱解析プログラムによって求めた結果(点線)を、実機の実測結果(実線)とともに示す。座標0 r * < 0. 12において、実機では図5のA-A線付近に一定間隔を空けているものの、解析プログ ラムでは均一に発熱すると近似しているため、実機の温度分布を再現できていない。しか し、実機の測定結果に対する解析結果の平均誤差は6.3%であり、その他の領域におい ては精度よく再現できていることが分かる。

【実施例3】

【0058】

温度ムラの解析結果を実施例1と実施例2で比較すると、実施例1では16Kに対し、 実施例2では2Kであった。実施例2は実施例1に対して、温度ムラは1/8に低減して いることが分かる。実施例1と実施例2の設計パラメータの実質的な違いは基板面方向熱 伝導率k,であることから、温度ムラは基板面方向熱伝導率k,に影響されているものと 推測される。

そこで、実施例3では、簡略化のために基板面方向熱伝導率 k_r および基板厚さ方向熱 伝導率 k_z に代えて基板有効熱伝導率 k_eを用いるとともに、同様に放熱に影響する総括 伝熱係数(基板裏面冷却強度) h を用い、これらの設計パラメータを変更して温度ムラに 対する影響を調べた。具体的には、図10(a)に示す水中高輝度 L E D 照明装置60を 用い、形状および物性値を変更しながら熱解析シミュレーションを行い、温度ムラの解析 を行った。

【 0 0 5 9 】

[構造]

図10に水中高輝度LED照明装置60の(b)平面図、(c)断面図を示す。水中高 輝度LED照明装置60は、筐体61、基板62、レンズ63、および2つのOリング6 4を主な構成要素とする。

筐体 6 1 は、真鍮製の直径 1 1 1 mm、高さ 7 1 mmの略円筒形状であり、受熱部 6 1 a、側面部 6 1 b、複数のフィン 6 1 c、キャップ部 6 1 d、およびソケット部 6 1 eを 備えて構成される。受熱部 6 1 a は、その表面側に基板 6 2 が固着され、基板 6 2 より熱 を受ける。側面部 6 1 b は、その外周に複数のフィン 6 1 cを備え、受熱部 6 1 a で受け 10

た熱をフィン61cに伝導し、フィン61cはその熱を水中に放熱する。キャップ61d は、レンズ63を筐体61に固定する。ソケット部61eは、図示しない電源ケーブルを 筐体61内部へ案内する。

基板62は、図示しない高密度実装された多数個のLEDチップを実装する。基板62 に実装されるLEDチップの数は、例えば、172個である。基板62は、多数個のLE Dチップから発せられた熱を受熱部62aに伝導する。

レンズ63は、基板62に実装されたLEDチップから発せられた光を集光し、透過させる。

Oリング64は、側面部61bとレンズ63間、および側面部61bとソケット部61 e間に挟まれ、水の侵入を防ぐ。

【0060】

受熱部 6 1 a と基板 6 2 の詳細な構造について、図 1 1 を用いて説明する。図 1 1 は、 受熱部 6 1 a と基板 6 2 の (a)上面図、 (b)側面図、 (c)下面図を示す。

受熱部61 a は、半径 D 。、厚さ t の円盤状をしている。開口穴65 が形成されており 、開口穴65 の有無、穴径(半径) D i の変更によって受熱部61 a の表面に固着される 基板62との接触面積が変化し、総括伝熱係数 h を変化させることが可能となる。また、 厚さt が変わることにより、側面部61 b との接続断面積が変化し、総括伝熱係数 h を変 化させることが可能となる。すなわち、受熱部61 a の半径 D 。、穴径(半径) D i 、お よび厚さt を総括伝熱係数 h の代用とすることができる。ちなみに、穴径(半径) D i が 大きくなるほど、受熱部61 a と基板62 の接触面積が小さくなり、総括伝熱係数 h は小 さくなる。また、厚さt が大きくなるほど、側面部61 b との接続断面積が大きくなり、 総括伝熱係数 h は大きくなる。

[0061]

基板 6 2 は半径 L_{h s}、厚さ d の 円盤状の銅板または F G H P である。基板 6 2 の表面 には、複数 個 の L E D チップが高密度実装され、均一に発熱するものと近似可能した実装 領域 6 6 が形成されている。実装領域 6 6 は直径 R の 円形状をなしている。実装領域 6 6 が発した熱は入熱量 Q_{in}として基板 6 2 の実装領域 6 6 との接触部分に入熱する。入熱 量 Q_{in}は、例えば、実装領域 6 6 を形成する L E D チップの数が 1 7 2 個の場合、 1 チ ップあたりの消費電力を 3 . 2 V × 0 . 3 2 A = 1 . 1 2 W と仮定し、総消費電力の 8 0 % が熱となることを仮定すると、1 . 1 2 W × 1 7 2 × 0 . 8 = 1 5 4 W である。 【 0 0 6 2 】

以下、総括伝熱係数hおよび基板有効熱伝導率k。を変化させて行った熱解析シミュレーションの結果を説明する。本実施例の構成で登場する設計パラメータのうち、言及していない設計パラメータについては前述の説明のとおりであり、説明を省略する。 解析モデルの設計パラメータを表4~6に示す。

20

10

【 表 4	.]
-------	-----

設計パラメータ		実施例							
		3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7	
基板サイン	ズL _{hs} [mm]	30	30	30	30	30	30	30	
基板厚さの	J[mm]	2	2	2	2	2	2	2	
被冷却体	サイズR[mm]	40	40	40	40	40	40	40	
被冷却体	面積A[mm²]	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	
入熱量Q _{in} [W]		154.2	154.2	154.2	154.2	154.2	154.2	154.2	
環境温度T[K]		298.2	298.2	298.2	298.2	298.2	298.2	298.2	
基板有効	熱伝導率k _e [W/(m•K)]	387.6	387.6	387.6	387.6	387.6	387.6	387.6	
総括伝	受熱部外径(半径) $D_o[mm]$	43	43	43	43	43	43	43	
熱係数h の代用	受熱部穴径(半径)D _i [mm]	0	5	10	15	20	25	30	
	受熱部厚さt[mm]	5.00	5.07	5.29	5.69	6.38	7.55	9.74	
基板内最高温度T _{max} [K]		_	_	_	_	_	_	_	
基板内温度ムラT _{max} ーT _{min} [K]		_	_	_	_	—	-	_	

表 4 に示すように、実施例 3 - 1 ~ 3 - 7 では、基板 6 2 を銅板として、受熱部 6 1 a の穴径(半径)D、および厚さtを変えて総括伝熱係数hを変えたモデルである。すなわ 20 ち、基板有効熱伝導率 k 。は一定(387.6W/(m・k))のまま、括熱伝達係数 h を変えたモデルである。厚さtは、受熱部61aの熱容量を一定とするため、受熱部61 aの体積が一定となるように設定した。

[0063]

【表5】

設計パラメータ		実施例					0	
		3-8	3-9	3-10	3-11	3-12	3-13	3-14
基板サイ	ズL _{hs} [mm]	30	30	30	30	30	30	30
基板厚さ	d[mm]	2	2	2	2	2	2	2
被冷却体	サイズR[mm]	80	80	80	80	80	80	80
被冷却体面積A[mm ²]		18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
入熱量Q _{in} [W]		154.2	154.2	154.2	154.2	154.2	154.2	154.2
環境温度T[K]		298.2	298.2	298.2	298.2	298.2	298.2	298.2
基板有効熱伝導率k _e [W/(m・K)]		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
総括伝	受熱部外径(半径) $D_o[mm]$	43	43	43	43	43	43	43
熱係数h の代用	受熱部穴径(半径)D _i [mm]	0	5	10	15	20	25	30
	受熱部厚さt[mm]	5.00	5.07	5.29	5.69	6.38	7.55	9.74
基板内最	高温度T _{max} [K]	-		_	-	_	_	-
基板内温	度ムラT _{max} ーT _{min} [K]	_	-	_	_	_	-	-

表5に示すように、実施例3-8~3-14では、基板62をFGHPとして、受熱部 61 aの穴径(半径)D_iおよび厚さtを変えて総括伝熱係数hを変えたモデルである。 すなわち、基板有効熱伝導率 k 。は一定(1800W/(m・k))のまま、括熱伝達係 数hを変えたモデルである。受熱部61aの穴径(半径)D,および厚さtは、実施例3 - 1 ~ 3 - 7 と同様となるように設定した。

[0064]

10

30

【表6】

設計パラメータ		実施例				
		3-15	3-16	3-17	3-18	
基板サイズ	ズL _{hs} [mm]	30	30	30	30	
基板厚さの	d[mm]	2	2	2	2	
被冷却体	サイズR[mm]	80	80	80	80	
被冷却体面積A[mm²]		18000	18000	18000	18000	
入熱量Q _{in} [W]		154.2	154.2	154.2	154.2	
環境温度T[K]		298.2	298.2	298.2	298.2	
基板有効熱伝導率k _。 [W/(m・K)]		200	800	1200	2500	
総括伝	受熱部外径(半径) $D_o[mm]$	43	43	43	43	
熱係数h の代用	受熱部穴径(半径)D _i [mm]	30	30	30	30	
	受熱部厚さt[mm]	9.74	9.74	9.74	9.74	
基板内最高温度T _{max} [K]		-	—	_	-	
基板内温度ムラT _{m ax} ーT _{min} [K]		_	_	_	_	

表 6 に示すように、実施例 3 - 1 5~ 3 - 1 8では、受熱部 6 1 aの穴径(半径) D _i および厚さ t を実施例 3 - 7 および 3 - 1 4と同一として、基板 6 2の基板有効熱伝導率 20 k_eを変えたモデルである。すなわち、括熱伝達係数 h は一定のまま、基板有効熱伝導率 k_eを変えたモデルである。

【0065】

図12に実施例3-1~18の解析結果を示す。グラフの縦軸は温度ムラ、横軸はビオ 数Biを示す。ビオ数Biは、数11~13に従って、熱解析シミュレーションで求めた 実装領域66の中心温度T₆₆を用いて算出した熱抵抗R_{th(a11)}および括熱伝達 係数hによって求めた。ここで、被冷却体面積Aは、基板42と受熱部41aの接触面積 が受熱部41aの穴径(半径)D_iによって変化するため、共通するフィン43の放熱面 積を用いて算出した。

【数11】

$$R_{th(all)} = \frac{T_{66} - T_{\infty}}{Q_{in}}$$
R th(all) : 熟抵抗[K/W]
T 6 6 : 熱解析シミュレーションで求めた実装領域660中心温度[K]
T : 環境温度[K]
Q i n : 入熱量[W]
【数12】
 $h = \frac{1}{R_{th(all)}A}$
40
h : 総括伝熱係数(フィン61c放熱面積基準)[W/(m²·K)]
A : 被冷却体面積(フィン61cの放熱面積)[m²]
【数13】
Bi = $\frac{hR}{k_e}$

B i :ビオ数

R: 被冷却体サイズ [m]

50



10

20

30

40

(20)

k 。: 基板有効熱伝導率 [W/(m・K)] [0066]図12を見て分かるように、各実施例3-1~3-18とも、図12の点線で示す一つ の近似曲線上に沿っている傾向が見られる。すなわち、温度ムラはビオ数Biによってー 義的に求めることが可能である。したがって、温度ムラの仕様が決まれば、図12中の(1)から(2)の矢印のように近似曲線を辿り、放熱システムのBiを決定することが可 能である。 ビオ数は、数13のように、総括伝熱係数、サイズおよび基板有効熱伝導率で決まる値 である。上記の考え方によれば、放熱システムの設計において筐体の構成が先に決定され る場合、筐体に関する定常熱伝導方程式の解析解あるいは数値解によって総括伝熱係数が まず決定され、その結果として、基板に要求される有効熱伝導率を決定することができる 。逆に、基板の構成が先に決定される場合、基板の有効熱伝導率がまず決定され、その結 果として、筐体に要求される総括伝熱係数を決定することができる。 [0067]以上に説明した実施例3によれば、放熱システムの設計パラメータを迅速に決定するこ とができる。 【符号の説明】 [0068]1 LED照明モジュール 1 0 実装領域 11 LEDチップ 12、12a、12b 配 線 13、13a、13b 外部電極端子 14 ワイヤ 15 保護ダイオード 20 基板 20B 裏面 2 1 無機系白色絶縁層 22 ダム材 23 透光性樹脂 2 4 無機系白色絶縁層 30~33 液冷クーラー 30 金属ブロック 30A 表面 循 環 流 路 31 32 入口 33 出口 4 0 入出力画面 4 1 設計パラメータ名称欄 42 設計パラメータ入出力欄 43 設定欄 4 4 計算結果表示欄 45 計算実行ボタン 60 水中高輝度LED照明装置 6 1 筐体 6 1 a 受熱部 6 1 b 側面部 6 1 c フィン 6 1 d キャップ部 61 e ソケット部

6	2	基 板
6	3	レンズ
6	4	0リング
6	5	開口穴
6	6	実装領域







10





【図9】











フロントページの続き

(72)発明者 福田 賢司 香川県仲多度郡多度津町南鴨200番地1 四国計測工業株式会社内 Fターム(参考) 5E322 AA05 AB10 DA01 FA01 FA05 5F136 BB01 DA33 5F142 AA42 AA46 BA32 CA02 CB17 CB23 CD02 CD13 CD32 CD43 CE03 CE06 CE08 CE15 CF02 CF23 CF34 CG03 CG45 DA02 DA12 DA22 DA23 DA32 DA72 DA73 DB32 GA21